

第17回半導体材料・デバイスフォーラム プログラム

セッション	No.	氏名	所属	講演タイトル
開会		角田 功	熊本高専	
9:05～10:35				
基調講演	P-1	百瀬 健	熊本大学	半導体概論と熊本における半導体産業
	P-2	井原 敏博	熊本大学	熊本大学における半導体分野の研究・人材育成の取り組み
企業招待講演	I-1	松山 雄二	東京エレクトロン九州	熊本高専－東京エレクトロン長期インターンシップによる人材育成モデルの紹介
10:45～12:02（修士・学部学生1件当たり10分＋質疑2分） 学生口頭発表第1会場				
一般講演 第1会場 (学生発表)	O-1	小川 顕 (茨城高専卒)	筑波大学	高Ge組成SiGe薄膜／ガラスにおける近赤外分光感度の実証
	O-2	伊礼 壮良	熊本大学	テラヘルツ波デバイス形成に向けた超臨界流体薄膜堆積報の構築
	O-3	山下 慶	舞鶴高専	LTspiceを用いた抵抗スイッチングモデルの理論的検証
	O-4	小田 翔太 (北九州高専卒)	熊本大学	超臨界流体を用いた薄膜堆積技術とインフォマティクスを活用したプロセス設計
	O-5	嶋 遥太	東京科学大学	PVD-AlN/Si(111)基板上PVD-WS ₂ 膜
	O-6	出森 麗央	九州工業大学	Sn添加β-FeSi ₂ 薄膜の作成
10:45～12:02（修士・学部学生1件当たり10分＋質疑2分） 学生口頭発表第2会場				
一般講演 第2会場 (学生発表)	O-7	島袋 颯馬 (沖縄高専卒)	北陸先端科学技術大学院大学	レーザー補助FLAによる非晶質Si膜の爆発的結晶化起点制御の実証
	O-8	福島 優太	熊本高等専門学校	MgO膜質がGe薄膜の固相成長特性に及ぼす影響
	O-9	野田 浩矢 (有明高専卒)	九州大学	ダイヤモンドライカーボンをゲート絶縁膜としたグラフェンFETのプロセス設計と特性評価
	O-10	永野 稜真 (都城高専卒)	熊本大学	ポリマーヒートパイプの形成と評価 ～半導体冷却を目的として～
	O-11	村田 和真	熊本大学	V/TaO _x 基スレッショルドスイッチングメモリスタの電子顕微鏡解析
	O-12	大友 琳央	熊本大学	ピーニングによるステンレス鋼の表面改質と表面特性予測GUIの構築
12:02～13:10 昼食				
セッション	No.	氏名	所属	講演タイトル
13:10～16:00 大学セミナー				
第1会場		大学セミナープログラムをご確認ください。		
第2会場				
13:10～16:00 企業セミナー				
14:00～ 技術課題 セッション				
16:15～17:45 学生ポスター発表				
学生ポスター展示		ポスター発表プログラムをご確認ください。 奇数番号コアタイム：16:15～17:00 偶数番号コアタイム：17:00～17:45		
閉会				

学生ポスター発表 プログラム

No.	氏名	所属	講演タイトル
P-1	矢吹 和詩	筑波大学	垂直配向多層グラフェンの合成とLiイオン電池負極応用
P-2	高細工 彩斗 (熊本高専卒)	九州大学	数層hBNのCVD成長と磁気トンネル接合素子への応用
P-3	吉川 音々 (鹿児島高専卒)	九州大学	同軸型アークプラズマ堆積法を用いた ダイヤモンド上ナノカーボン電極の評価とデバイス応用に向けた検討
P-4	進藤 花菜	佐賀大学	機械学習による太陽電池J-V特性からの 単一ダイオードモデルパラメータ推定
P-5	前田 将吾	熊本高専	高圧熱処理とMgO挿入の併用による 非晶質Geの低温固相結晶化への影響
P-6	松本 蒼生	九州工業大学	メサ型β-FeSi ₂ pnホモ接合素子における 電極形状の暗電流特性への影響
P-7	岩崎 正悟	舞鶴高専	連成シミュレーションによる抵抗変化メモリの動作解析
P-8	桂下 聖哉	宮崎大学	フォトルミネッセンス測定を用いた 圧縮歪超格子太陽電池におけるキャリア輸送過程の優位性解析
P-9	川崎 天聖	豊橋技術科学大学	熱輻射発電応用に向けた第一原理計算およびMBE成長による GaSbN混晶の熱力学的安定性評価
P-10	中原 大葉 (熊本高専卒)	九州大学	高濃度ホウ素ドーパダイヤモンド結晶成長における金属不純物の効果
P-11	波多野 勇輝	九州大学	単結晶ダイヤモンドの可視光検出性能へのNVセンタ密度の影響
P-12	岸田 遥斗	舞鶴高専	磁界共鳴方式ワイヤレス給電に適する材料の検討
P-13	中村 大輝	九州工業大学	希釈溶媒がGaNのウェットエッチングに及ぼす影響
P-14	楼 厲寧	九州大学	医療機器応用に向けたナノダイヤモンド膜表面への疎水性付与
P-15	加藤 天音	九州工業大学	薬液処理後の(001)β-Ga ₂ O ₃ の表面形態および化学状態評価
P-16	森野 達也 (木更津高専卒)	東京科学大学	スパッタHf膜の硫黄雰囲気中アニールによるHfS ₂ 膜の形成
P-17	阿部 颯太 (久留米高専卒)	熊本大学	結晶性アルミノケイ酸塩SSZ-13の組織制御 ～磁気的特性付与による新しい試み～
P-18	秋山 佳範 (北九州高専卒)	熊本大学	イメージセンサにおけるノイズ抑制評価
P-19	宇都 佑紀	九州工業大学	金属窒化物電極を用いたβ-Ga ₂ O ₃ SBDの電気特性評価
P-20	小倉 三月	熊本大学	分子動力学計算を用いたカーボンナノチューブ熱伝導特性評価
P-21	石田 栞大 (北九州高専卒)	熊本大学	短TAT・グリーン化を実現する次世代ALD技術： 製膜プロセスの「その場観察」と「オンデマンド原料供給」
P-22	竹原 タ二郎	熊本大学	IR-OBIRCH 測定データにおける TSV信号抽出のための背景除去手法検討
P-23	木稲 菜緒 (久留米高専卒)	熊本大学	非鉛系有機無機ハイブリッド誘電体 (CHA)4BiMX8(M = Ag/Cu, X = Br/I)の合成と結晶構造および光学特性評価
P-24	山本 航太郎	熊本大学	非鉛系有機無機ハイブリッド誘電体(CHA)4BiAgBr8-8xI8xの バンドギャップ制御
P-25	山口 悟史 (福島高専卒)	熊本大学	希土類・チタン系新規フェリ誘電体セラミックスの開発